

石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー
高性能吸着剤「ハスクレイ」の開発経緯とその応用展開
開催のご案内

主催：公益財団法人 石川県産業創出支援機構
協力：石川県工業試験場

天然の多孔質材料である「イモゴライト」の吸放湿性に着目し、実用化が可能な安価な材料を用いた高性能吸着剤「ハスクレイ」の合成に成功しました。

本講座では、近年の省エネ・環境意識の高まりによりその応用展開として、デシカント空調用水蒸気吸着材や園芸栽培用二酸化炭素吸着材、さらに低温廃熱に適応可能な蓄熱材としての応用事例について紹介します。多数ご参加くださいますようお願いいたします。

[日 時] 平成30年 6月28日(木) 14:00~16:00

[場 所] トライアルセンター 第2研修室(石川県工業試験場 5階)

[講 師] 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門

研究グループ長 **鈴木 正哉 氏**

[受講料] 1,000円(当日ご持参ください)

[定 員] 20名

[担 当] 石川県工業試験場 化学食品部 専門研究員 佐々木直哉

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地(石川県工業試験場 企画指導部内)

公益財団法人 石川県産業創出支援機構 産業振興部 次世代講座担当

e-mail: seminar@iriii.jp

TEL: (076)267-8081 FAX: (076)267-8090

[締切り] 平成30年 6月21日(木) (定員になり次第締切ります)

————— 受講者は下記内容を記入してFAXでお申込みください —————

石川県次世代産業育成講座：高性能吸着剤「ハスクレイ」の開発経緯とその応用展開

日 時：平成30年 6月28日(木) 14:00~16:00

場 所：トライアルセンター 第2研修室(石川県工業試験場 5階)

会 社 名

住 所(〒)

電 話

FAX

所 属	氏 名	e-mail